

初心者歓迎



川崎市

「ナノファブスクエア」開催案内

新川崎・創造のもりのNANOBI Cオープンラボ実施
ナノ・マイクロ技術講習・実習会

	プロセスに用いる装置	装置型式	日程予定
	1 超解像度レーザー顕微鏡	ライカマイクロシステムズ/STED-CW	3/9(木)
マイクロ流路 パターン作製	2 レーザー直接描画装置	ハイデルベルグインストルメンツ/DWL66fs	5/12(金)
	3 クラスタ型コータデベロッパ スピコータ	ズース・マイクロテック/GAMMA ミカサ/MS-A200	
	4 手動両面マスクアライナ	ズース・マイクロテック/SUSS MA6 BSA	
	5 光干渉式膜厚測定装置	大日本スクリーン製造/VM-1200	
マイクロ流路 鑿型作製	6 シリコン深堀りDRIE装置	住友精密工業/MUC-21	以降原則毎月 第2第4の 木曜又は金曜 にて実施
	7 触針式表面形状測定器	ブルカー・エイ・エックス・エス/DEKTAK XT-A	
	8 高密度プラズマドライエッチング装置	アルバック/NLD-570	
	9 超高解像度表面形状計測装置	ブルカー・エイ・エックス・エス/WYKO NT9100A	
マイクロ 流路作製	10 PDMS		
	11 レーザー顕微鏡	キーエンス/VK-8510	
電極 作製	12 4元マグネトロンサイドスパッタ装置	芝浦メカトロニクス/CFS-4EP-LL	
	13 Au/Cr ウェットエッチング		
チップ化	14 ECR イオンビームスパッタ成膜装置	エリオニクス/EIS-230W	
	15 ダイシングソー	ディスコ/DAD-522	

場所

川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり かわさき新産業創造センター (KBIC) 新館 NANOBI C (JR新川崎駅から徒歩10分)

実習概要

マイクロ流路の一連の試作を、シリコン、ガラス、樹脂を使い実施し、表面形態の観察・評価までを行うプログラムにより、目的に応じた受講が可能です

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)、川崎市

共催：機械学会、次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

定員：5名程度(先着) 参加費：原則実費(個別チラシに費用を掲載)を負担いただきます。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、産学連携による技術や産業の創出に寄与するため、川崎市、KISTECと連携し、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBI C」において、4大学の先端機器の開放利用を行っています。今後、4大学の機器を更に効果的にご利用いただくため、企業や大学の方を対象としたナノ・マイクロ技術講習・実習会『ナノファブスクエア』の個別チラシを順次掲載し開催して参りますのでご参加ください (NANOBI Cオープンラボホームページ <http://open-labo.skr.jp/>)。

「NANOBI Cオープンラボ」
ホームページに随時掲載、
開放利用機器の詳細仕様は
機器一覧をご覧ください。



問合せ窓口：唐澤志郎 Tel: 080-6560-3061 / E-mail: karasawa@newfast.or.jp

(地独) 神奈川県立産業技術総合研究所

※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金をご利用できます

(URL: <http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000085717.html>) のでご相談ください。